

# 第5回ケミカルプロセス研究討論会

英文プログラム名 The Fourth Meeting on Chemical Processing of Ceramics

開催日:2012年3月19日(月)9:00~12:00 開催場所:H会場

主催団体名 :ケミカルプロセス研究討論会

概要 開催内容 :ケミカルプロセスに関する講演会を下記の通り開催致します。

9:00~9:30 「ナノシートの表面修飾とその応用」(早稲田大学)菅原義之

9:30~10:00 「ゾルゲル法により作製されるセラミック薄膜の面内応力について」  
(関西大学)幸塚広光

10:00~10:30 「低炭素 SiOC および SiOC(H)セラミックスの特徴と機能」  
(大阪府大学)成澤雅紀

10:30~11:00 「アモルファスシリカ系材料の高温水素反応挙動」(名工大)岩本雄二

11:00~11:30 「液相レーザーアブレーション法による酸化物ナノ粒子の合成」  
(法政大学)石垣隆正

11:30~12:00 「メソポーラスシリカの複合化と吸着触媒機能開発」  
(九州大学)北條純一・稲田幹

参加対象者 :会員(個人・教育・シニア), 学生会員, 非会員

参加費 :無料(事前申し込みは不要です)

## 連絡者

名前 :菅原義之 (早稲田大学理工学術院)

TEL/FAX :03-5286-3204

勤務先所在地 :〒169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1

E-mail :ys6546@waseda.jp